

УДК 539.21

ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ РОМБОЭДРИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ КАРБИДА КРЕМНИЯ

Г. Б. Дубровский, Ф. Г. Пикус

Рассчитаны энергетические спектры электронов зоны проводимости для ромбоэдрических модификаций карбида кремния $15R$, $21R$ и $24R$. Потенциал естественной сверхрешетки, образованной периодически чередующимися участками кубической структуры с прямой и зеркальной последовательностью слоев, аппроксимируется моделью Кронига—Пени с двумя различными ямами на периоде. Рассчитаны пространственная локализация электронов в потенциальных ямах естественной сверхрешетки и вероятности оптических переходов между минизонами. Результаты расчета сопоставлены с имеющимися экспериментальными данными, определены пределы применимости используемой модели.

Как известно [1], все α -модификации карбида кремния, кроме $2H$, представляют собой естественные сверхрешетки (ЕСР), являющиеся результатом периодического чередования вдоль оси кристалла участков кубической структуры β SiC с прямой (ABC) и зеркальной (CBA) последовательностями укладки слоев. Сдвиг фазы электронной волны на плоских границах этих зеркально-симметричных участков описывается введением потенциальных барьеров. Таким образом, потенциальная энергия вдоль оси ЕСР имеет вид периодически расположенных потенциальных ям, разделенных одинаковыми барьерами (рис. 1, вставка). В работах [2, 3] была предложена модель для расчета электронных спектров кристаллов SiC, аппроксимирующая реальный потенциал барьера ЕСР прямоугольным. Параметры барьеров (высота W , ширина d и эффективная масса электронов m_β исходного кристалла β SiC в направлении [111], совпадающем с осью z ЕСР) в этой модели определялись из условия наилучшего согласия результатов расчета с экспериментальными данными по межминизонному оптическому поглощению в гексагональных модификациях SiC. При этом перекрытие реальных потенциалов соседних барьеров, зависящее от расстояния между ними $b = Nc$ (N — число двойных Si—C слоев в кубической решеткой, составляющих потенциальную яму; c — толщина одного слоя), учитывалось введением «подставки» W_0 , поднимающей дно потенциальной ямы. При вычислении электронных спектров ромбоэдрических модификаций SiC в работе [3] использовались усредненные по ямам различной ширины значения W_0 .

В данной работе выполнен более точный расчет электронных спектров простейших ромбоэдрических модификаций SiC $15R$, $21R$, и $24R$, содержащих по две различающихся потенциальных ямы на периоде ЕСР (их обозначения в символах Жданова соответственно $(23)_3$, $(34)_3$ и $(35)_3$) с учетом зависимости W_0 от ширины ям. Решение уравнения Шредингера и определение собственных функций и собственных значений выполнялись на ЭВМ. При расчете использовались те же, что и в [3], значения параметров: $m_\beta = 1.75m_0$, где m_0 — масса свободного электрона, $W = 2.4$ эВ и $d = 0.9$ Å,

но разные для различных потенциальных ям «подставки»: $W_0(2)=0.6$, $W_0(3)=0.4$, $W_0(4)=0.3$ и $W_0(5)=0.25$ эВ. Здесь в скобках при W_0 указана ширина потенциальной ямы в единицах числа слоев β SiC.

1. Энергетические спектры

На рис. 1 приведены рассчитанные электронные спектры для первых пяти минизон в модификациях $15R$, $21R$ и $24R$ SiC. Стрелками на оси ординат рис. 1, а, б указаны энергии переходов для $15R$ и $21R$ SiC, наблюдавшихся в поглощении [3], которые в основном хорошо согласуются с данными вычислений. Для структуры $24R$ опубликованных экспериментальных данных нет.

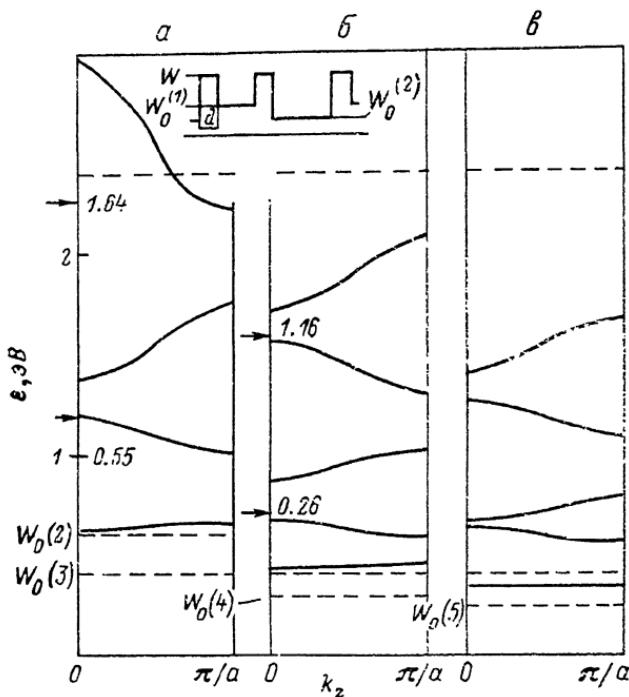


Рис. 1. Энергетические спектры первых пяти минизон для модификаций SiC: а — $15 R$, б — $21 R$, в — $24 R$.

Погрешности при определении энергий переходов в принятой модели связаны в первую очередь с заменой реального сложного потенциала прямоугольным. Для нижних минизон такая замена при удачном подборе параметров может давать результаты, близкие к точным, однако по мере роста энергии модельный потенциал все сильнее отличается от реального, поскольку реальный барьер, очевидно, кверху сужается. При этом вычисленные значения энергий верхних минизон и соответственно энергий переходов оказываются завышенными, особенно в узких ямах, поскольку в этом случае относительное изменение ширины потенциальной ямы при замене реального барьера модельным наибольшее. Действительно, как видно из рис. 1, расхождение расчетных и экспериментальных данных для модификации $15R$ значительно больше, чем для $21R$.

2. Вероятности переходов

С использованием описанной модели были рассчитаны вероятности оптических переходов между различными минизонами. На рис. 2 приведены модули матричных элементов электродипольного перехода (в относительных единицах) для модификаций $21R$ и $24R$. Матричные элементы для $15R$ выглядят аналогично $21R$ SiC. В рамках одномерной модели, оче-

видно, рассматриваются только переходы под действием света с поляризацией $E \parallel z$, где z — ось сверхрешетки. При различных температурах переходы могут происходить из первой минизоны или с уровней мелкого донора (азота), причем, как показано в [4], правила отбора для этих переходов совпадают. Важной особенностью одномерных структур является обращение в бесконечность плотности состояний в точках $k_z=0$ и $k_z=\pi/a$ (a — период сверхрешетки) по закону $1/\sqrt{\epsilon}$, где ϵ — энергия движения вдоль оси z , что приводит к резкому росту коэффициента поглощения для переходов в этих точках. Таким образом, наряду с переходами в точке $k_z=0$ возможны также и переходы в точке $k_z=\pi/a$, которые могут происходить с донорного уровня или при достаточно высоких температурах из первой минизоны, что должно приводить к появлению дополнительной структуры в спектрах межминизонных переходов.

Сравнение результатов расчета (рис. 2) с экспериментальными данными показывает, что расчетные правила отбора для ромбоэдрических модификаций SiC не согласуются с экспериментом. В частности, резко противоречит расчету тот факт, что оптические переходы в третью минизону не на-

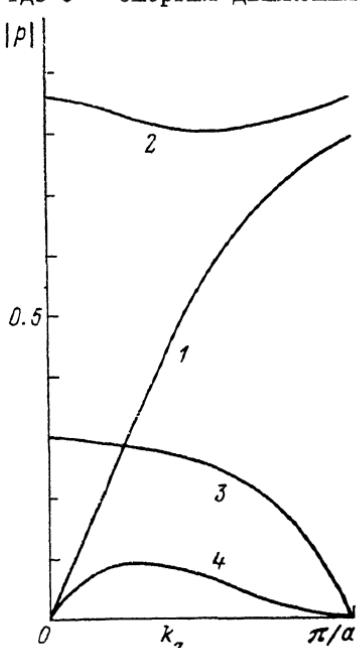


Рис. 2. Матричные элементы электродипольного перехода из первой минизоны в верхние.

1 — во вторую, 2 — в третью, 3 — в четвертую, 4 — в пятую для структуры 21R SiC.

блюдаются, хотя, как видно из рис. 2, они должны быть разрешены. По-видимому, здесь мы сталкиваемся с ограниченной применимостью используемой модели. Такие причины, как сложная структура реального потенциала в барьере или подмешивание состояний других зон (например, валентной зоны) к верхним минизонам, могут изменить вид волновых функций и, следовательно, матричных элементов, в то же время почти не сказываясь на энергетическом спектре минизон. Очевидно, следует с осторожностью подходить к использованию рассчитанных матричных элементов межминизонных переходов и других величин, чувствительных к точным значениям фазы волновых функций.

3. Пространственное распределение электронов

В рамках используемой модели можно вычислить вероятность нахождения электрона в данной потенциальной яме в виде

$$\omega = \int |\psi|^2 dz. \quad (1)$$

Здесь ψ — волновая функция электрона в яме, а интеграл берется по ширине ямы. Отметим, что в данном случае результат не зависит от фазы волновых функций, поэтому его, как и расчетные энергии, можно считать достоверным. Оказывается, что вероятности нахождения электрона в разных ямах резко различаются, особенно для низких минизон. На рис. 3 приведены минизоны модификаций 21R и 24R SiC и указаны вероятности пребывания электронов в соответствующих ямах. Видно, что локализация электронов очень велика. Это означает, что взаимодействие между различными потенциальными ямами есть малое возмущение и мини-

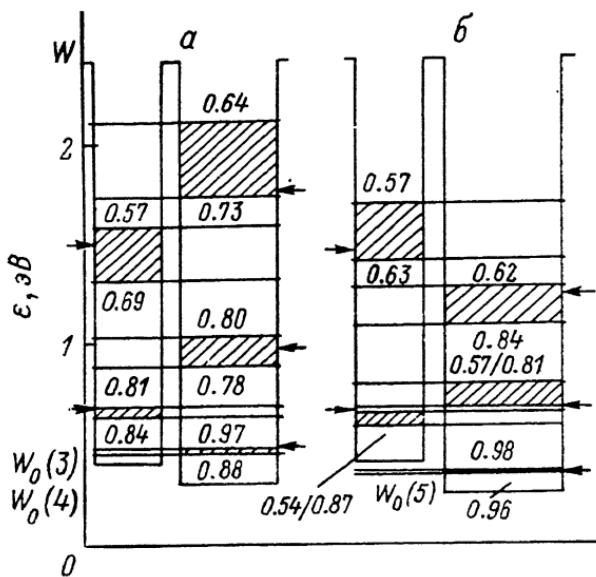


Рис. 3. Пространственное распределение электронов.

Числа указывают вероятности нахождения электронов минизоны в данной яме, верхние — при $k_z=0$, нижние — при $k_z=\pi/a$. Стрелками обозначены положения уровней энергии в ионизированных потенциальных ямах. а — 21R, б — 24R SiC.

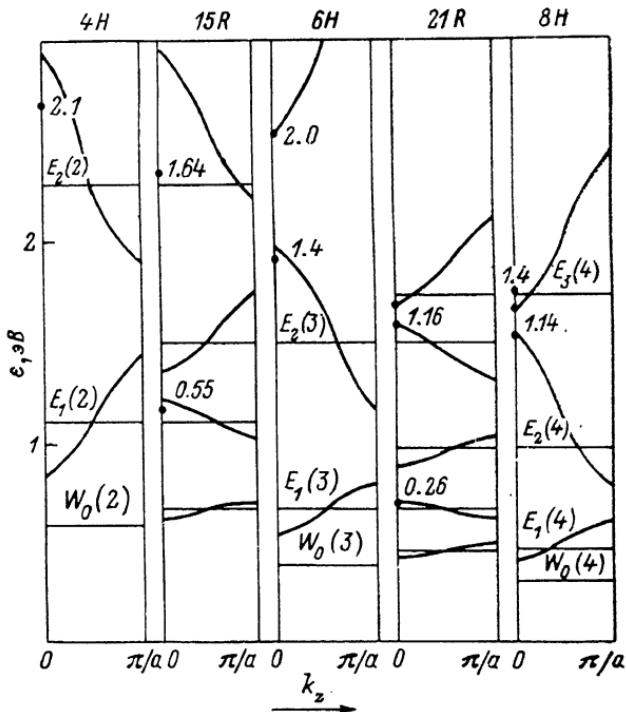


Рис. 4. Сравнение спектров ромбоэдрических структур с гексагональными, содержащими потенциальные ямы такой же ширины.

Черные кружки показывают наблюдавшиеся переходы, цифры дают их энергию в эВ. $\epsilon_i(N)$ — энергия уровня i в яме шириной в N слоев β SiC.

зоны происходят в основном из собственных уровней энергии соответствующих ям. Действительно, из рис. 3 видно, что минизоны близки к энергиям уровней в изолированной потенциальной яме соответствующей ширины и глубины, которые даются уравнением

$$\operatorname{tg}(\sqrt{2m\varepsilon} b/\hbar) = -2\sqrt{\varepsilon(U-\varepsilon)/(U-2\varepsilon)}. \quad (2)$$

Здесь ε — энергия уровня, $U=W-W_0$ — глубина ямы, b — ее ширина.

Столь высокая локализация электронов позволяет делать хорошие оценки для характерных энергий минизон, используя только энергии уровней в изолированных ямах. Так, например, изменение ширины запрещенной зоны различных модификаций по сравнению с невозмущенным кристаллом в SiC, равное энергии первой минизоны, приближенно может быть получено из энергии основного состояния в самой широкой яме.

Из сказанного выше следует, что энергии минизон в ромбоздрических модификациях SiC должны быть близки к энергиям минизон гексагональных модификаций, имеющих ямы такой же ширины. Это подтверждается рис. 4, на котором показаны спектр ромбоздрической модификации $15R$, у которой одна яма имеет ту же ширину, что и в гексагональной структуре $4H$, а другая — ту же, что и в $6H$, и ромбоздрической модификации $21R$, у которой различные ямы имеют ту же ширину, что и в структурах $6H$ и $8H$. Видно, что половина минизон модификации $21R$ SiC располагается близко к минизонам $6H$, а другие — к минизонам $8H$. То же самое наблюдается и в $15R$ SiC.

Таким образом, используемая модель хорошо описывает энергетические спектры модификаций SiC и можно попытаться предсказать некоторые явления, связанные с особенностями их минизонных спектров. Например, возможна ситуация, когда уровни двух изолированных потенциальных ям разной ширины с разными номерами совпадают. Как указывалось в [5], при этом минизоны расходятся, образуя аномально узкую щель, и все величины вблизи точки $k_z=0$ зависят от k_z очень резко. Согласно нашим расчетам, такая ситуация имеет место в структуре $24R$ SiC (рис. 1, в; 3, б), где близкими оказываются второй уровень в широкой яме и первый уровень в узкой яме.

Л и т е р а т у р а

- [1] Дубровский Г. Б. // Проблемы физики и технология широкозонных полупроводников. Л., 1980. С. 150—164.
- [2] Дубровский Г. Б., Погорельский Ю. В. // ФТП. 1974. Т. 8. № 4. С. 819—822.
- [3] Дубровский Г. Б., Лепшева А. А. // ФТП. 1977. Т. 19. № 5. С. 1252—1257.
- [4] Dubrovskii G. B., Belyavskii V. J. // Phys. St. Sol. (b). 1981. V. 103. N 1. P. 131—137.
- [5] Пикус Ф. Г. // ФТП. 1988. Т. 22. № 5. С. 940—943.

Физико-технический
институт им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
19 мая 1988 г.